パルス SPM を用いた金表面における仕事関数の計測

Work function measurement on gold surface using pulse SPM

システム工学群 極限ナノプロセス研究室 1240011 伊藤 祐吉

1. 諸言

仕事関数は、電子を物質内部から取り出すのに必要な最小 エネルギーで、電子デバイスの設計や評価には欠かせない値 である.従来、仕事関数は測定技術の限界から、試料全体に わたるマクロな物理量として測定されてきた.一方、近年の 微細加工技術の進展に伴い、表面の局所領域での精密な仕事 関数の計測が求められるようになってきた.このような局所 仕事関数(LWF)を原子レベルで計測する上で、走査プローブ 顕微鏡(SPM)が利用されている.たとえば、走査トンネル顕 微鏡(STM)を用いると「試料表面と探針先端原子の LWF 平 均値」に相当する局所トンネル障壁高さ(LBH)を評価できる ⁽¹⁾.また、原子間力顕微鏡(AFM)では「試料表面と探針先端 原子の LWF の差」に相当する局所接触電位差(LCPD)を評価 できる⁽²⁾.しかし、これらの測定量は、試料の LWF そのもの ではなく「差」や「平均値」を示すものである.

この問題を解決すべく,LBH とLCPD の同時計測により LWF の絶対値を直接測定するパルス SPM の開発が進められ ている⁽³⁾.現在,このパルス SPM は半導体試料を対象に手法 が確立されつつある.そこで,本研究では,LBH 測定に焦点 を絞り,パルス SPM が半導体以外の材料へも適用可能か検 証することを目的とした.具体的には,金属表面[Au(111)表 面]を対象に,パルス SPM の基盤となる AFM/STM 複合装置 を用いた LBH の計測を行った.

2. パルス SPM による LBH の測定原理

パルス SPM によるトンネル電流測定の原理を図1に示す. 本装置は AFM と STM の複合装置をベースとしている.通 常の AFM/STM システムにおける測定では、導電性のカンチ レバーを試料に近接させ、定振幅で振動させる.この状況で は、探針と試料間の距離zはカンチレバーの振動周期に従っ て時間的に変化するため、試料に印可している直流電圧 VDC に応じて、トンネル電流 $I_t(t)$ も図1の破線に示すように時間 的に変化する.ただし、I_t(t)の変化はシステムの検出帯域よ りも高速なため、実際の測定では時間平均量として検出され る. 一方, パルス SPM では, VDCの代わりにカンチレバーの 振動周期に同期したパルス電圧を特定のタイミングτで印 可する. その結果, パルス印可中のトンネル電流成分のみが 平均値として検出される. ここでτをカンチレバーの振動周 期にわたって掃引すると、得られるトンネル電流 $I_t(\tau)$ はzに 依存した量 $I_t(z)$ に変換できる.これにより、従来のSTMと 同様に、トンネル電流理論に基づき LBH を評価できる.



Fig.1 Principle of measuring tunneling current using pulse SPM

実験方法(装置構成と試料作製条件)

パルス SPM を構築するために, 超高真空 AFM/STM 装置 にパルス電圧を生成する任意波形発生器(WX2182C, TABOR 社製)と,任意波形発生器を制御するための自作コントロー ラを実装した.導電性カンチレバーには Pt/Cr をコーティン グした Si 製カンチレバーを使用した.測定に用いた Au(111) 表面にはマイカ上の金膜(Au/mica)を採用した.試料は,原子 レベルで平坦かつ清浄な(111)表面を得るため,超高真空チャ ンバーに導入後,Ar+スパッタリング(真空度は1×10⁻⁹torr, イオンエネルギーは 0.7keV)とアニーリング処理(試料温度は 500°C)を行った.

実験結果と考察

4.1 AFM/STM を用いた LBH の計測

図2に清浄化処理を施した Au(111)表面の STM 観察結果を 示す.図から,表面上には不純物が存在せず,Au(111)表に 特有のヘリンボーン構造⁽⁴⁾が形成されていることが確認さ れた.



Fig.2 STM image of Au(111) surface (50nm \times 50nm).

2章で述べたように、パルス SPM では、カンチレバーを定 振幅で振動させながら、その振動に同期させたパルス電圧を 印可してトンネル電流を検出する. この複雑なシステムにお いては、各動作がトンネル電流量に与える影響を個別に検証 する必要がある.そこで,本研究では,まず,通常のAFM/STM 測定と同様の条件(直流電圧を印可)でトンネル電流の探針試 料間距離依存性1+(Z)を測定した.ただし、ここで Zは探針の 振動中心位置と試料表面の間の距離を指す.図3(a)の黒線は 測定で得られた1₄(Z)を示している. 図から, カンチレバーを 振動させた状態であっても、L(Z)が通常の STM と同様に指 数関数的依存性を示すことが確認できる. 図中の赤曲線は, lt(Z)をトンネル電流の理論式(1)に基づいてフィッティングし た結果を示している.この結果からI_t(Z)がトンネル電流理論 で合理的に記述できることが示された. さらにこのフィッテ ィングによって得られた LBH の値は 5.52eV であり,一般的 な STM で評価される値(5.18eV)ともよい一致を示すことが 確認された.

4.2 計測の再現性について

図 3 は、AFM/STM ダイナミックモードにおいても、通常 の STM と同様に正確なトンネル電流測定と LBH の評価が 可能であることを示している.しかしながら、測定の再現性 には課題が存在することが明らかとなった.図4では、図 3 と同じ条件で $I_t(\overline{z})$ を計測した結果を示している.図から、 $I_t(\overline{z})$ は、 $\overline{z} < 0.12$ nm で、トンネル電流の理論式から逸脱し ていることが明らかである.

図4に示すような結果は、半導体表面を対象にした測定⁽³⁾ においても報告されており、その原因は、探針原子と表面原 子間に形成される化学結合に由来すると考えられている.し かし、本実験では探針も試料も金属であり、上記の考察が適 用されない.そこで、考えられる要因は、探針-試料間距離減 少に伴う LBH の低下である.物質の表面には電子の染み出



Fig.3 (a) Tunneling current as a function of tip-sample distance measured by AFM/STM (black). The red curve is the fit of the data. (b) schematics of the measurement procedure of (a).



Fig.4 Tunneling current as a function of tip-sample distance measured by AFM/STM. The red curve is the fit of the data.

しが起こっている.このため、実際にはエネルギー障壁の形 状は直線的ではなく、なだらかになっている.この探針側の 染み出しと試料側の染み出しが重なることで、LBH が低下す る⁽⁵⁾.トンネル電流理論式から、LBH が低下すると指数関数 の傾きは小さくなる.この効果によって、原子間に流れる電流 はトンネル電流理論から逸脱すると考える.一方、このよう な複雑な現象を排除して、簡略化されたトンネル電流理論の もとで LBH の評価を実現するには、上記現象を十分に無視 できる *z*においてトンネル電流を安定かつ高感度に検出す る必要がある.この課題は、より複雑な条件で計測を行うパ ルス SPM では本質的に重要だと考えられる.

5. まとめと今後

本研究ではパルス SPM の汎用性を確立することを目的と して, Au(111)表面上で AFM/STM を使用し,トンネル電流の 距離依存性を計測することに焦点を当てた.その結果,得ら れた*I*_t(*z*)は,従来の STM と同様に一般的なトンネル電流理 論で説明可能であることが示された.一方で,計測の再現性 には課題が残ることが明らかとなり,今後,予定しているパ ルス SPM を使用した LBH 測定においては本質的に重要であ ることが示された.

文献

- S. Yagyu and M. Yoshibu, "Bias Voltage Dependence of "Work Function" at Nanometer-Scale by Scanning Tunneling Microscope", JAS, Vol.9 (2002), pp. 488-500.
- (2) 北村真一, "超高真空ノンコンタクト原子間力顕微鏡の 開発とその応用", JSAC, Vol.5 (2008), pp.157-169.
- (3) 日笠響貴, "パルス走査プローブ顕微鏡を用いた局所分 光法の開発", 高知工科大学(2022).
- (4) H.hara, "Fabrication of Au(111) Single Crystalline Substrate on Mica", RIKEN, Vol.21,(2000),pp224-230.
- (5) M.Tsukada, "Quantum Mechanical Basis of Field Emission", jvss, Vol.23(2002), pp9-17.